# デジタルオフセット技術による石垣模様の検出

# 乾 正知

茨城大学工学部システム工学科

E-mail: Masatomo.Inui@dse.ibaraki.ac.jp

デジタル・アーカイブ技術を用いて,発掘された石垣の記録作業を効率化する研究が進んでいる.現在最も一般的な レーザ・レンジファインダによる計測では,石と石の隙間部分を精度よく測定できないため,得られた石垣の多面体 モデルに荒れた形状が生じてしまう.われわれは多面体のオフセット技術を用いることで,隙間部分の形状の「荒れ」 を選択的に除去し,石積みの状態をより鮮明にする技術を開発したので報告する.レンダリング・ハードウェアを用 いたデジタルなオフセット技術により,この処理をごく短時間に,しかも安定におこなうことに成功した.

# Extraction of Stone Wall Pattern Using Digital Offset Technology

Masatomo INUI

### Dept. of Systems Engineering, Ibaraki University

#### E-mail: Masatomo.Inui@dse.ibaraki.ac.jp

Scanning and digitally recording the stone wall shape in the excavation site is actively studied. Typical laser rangefinder is not suitable for measuring the gap part between the stacked stones in the wall, and the result geometric model often has some visible roughness in such portions. In this paper, the author proposes a refining method of the gap shape of the stone wall model so that archaeologists can easily understand the pattern of stacked stones based on the model. Our implementation uses the polygon rendering hardware for accelerating the computation, which enables the refining operation in an interactive time period.

## 1 はじめに

発掘された文化財の情報を,正確に記録し後世へ伝える ことは,私たちの義務であり責任である.石垣のように移 設が困難な埋蔵物の場合には,現地でできるだけ正確に情 報を収集しなくてはならない.石垣の情報は,写真撮影や 現地での計測に基づいて,石積みの状態を正投影でスケッ チし記録することが一般的である.図1には,そのような スケッチの例を示した.積まれた石と石の隙間や石の輪郭 を太線で描き,さらに各石の特徴的な線を補足的に描くこ とで,石積みの状態を表現している.このようなスケッチ を正確に作成するには,かなりの熟練と時間を要する.し かし年間に1万件を超す発掘があり,その多くが開発工事 に伴う緊急発掘という現状では,作業時間に制限があり, 従来の記録法で対応することが難しくなってきている.

埋蔵文化財の,特に形状データを,非接触の3次元計測 器を用いて測定し記録するデジタル・アーカイプ技術が, 近年盛んに研究されている[1].デジタルに記録された情 報は劣化しないので,遺跡の資料的な価値を最大限保存 し,その情報を後日時間をかけて解析することが可能にな る.記録には,レーザ光をスリット状もしくはスポット状



図 1: 石垣の積み石の状態のスケッチ.石の輪郭と隙間の 部分を太線で強調して描き,各石の特徴的な線を補足的 に描き加えている(データ提供:日立エンジニアリング (株)).



図 2: レンジファインダにより得られた点群に基づいて作成した石垣の多面体モデルを,そのまま描画した結果.ポ リゴン数は 454,178 枚 (データ提供:日立エンジニアリング(株)).



図 3: 多面体表現された石垣モデルの部分拡大.石と石の 隙間の部分の形状が荒れている.

に照射し,三角測量の原理で距離を測定する,レーザ・レンジファインダを用いることが一般的である.しかし石垣の場合には,積まれた石の隙間の部分にはレーザ光が入らないため,その部分を十分な精度で記録することができない.図2に,レーザ・スポット式の計測装置(パルステック工業(株)製TDS-130L)を用いて石垣の表面を覆う点群を記録し,それを多面体化した結果を,また図3にはその一部を拡大した様子を示す.石と石の隙間部分の形状が荒れ,表示品質が低下していることが分かる.このような表示では,石積みの状態を正しく判断することが難しい.

本研究では,多面体モデルに対して幾何的な変換を施す ことで,石積みの状態をより鮮明にする技術を開発した ので報告する.この処理を適用すると,石垣を表す多面体 データから,低品質な荒れた形状を除去し,石の輪郭を際 立たせることができるので,処理結果に基づいて石積みの 状態を評価し,図1のようなスケッチを容易に作成できる. 提案する手法では,多面体に対するオフセット処理を繰り 返し適用する.石垣形状は,数十万から百数十万枚の微小 なポリゴンで表現されているので,通常のソフトウェアに よるオフセット処理では,計算時間が膨大なものになって しまう.本研究では,スケッチを得るためには,石垣をあ る特定の方向から眺めた画像が得られれば十分なことに着 目し,レンダリング・ハードウェアを利用した超高速なオ フセット技術を用いることにした.その結果,対話処理が 可能な時間で石垣モデルを変換し,石積みの状態を鮮明に 表示することに成功した.

# 2 石積み状態の鮮明化

点群に基づいて作成された石垣の多面体モデルから,隙 間部の形状の荒れだけを選択的に除去し,石積みの状態を より鮮明にすることを考える.荒れた形状は,他の部分と 比較して形状変化が激しい部分と見なせるので,ある種の フィルター処理により,形状の高周波成分だけを除去する 手法がまず考えられる(例えば[2]).しかしこの手法では, 積石の角の部分も平滑化されてしまうため,石の特徴的な 形状が失われてしまう.そこで本研究では,多面体のオフ セット処理に基づく,新しい手法を用いることにした.





図 4: 石垣の多面体モデルの上を滑る,先端が半球形のプ ローブの様子.

### 2.1 基本的な考え方

レンジファインダを用いて石垣を計測する場合,測定結 果に荒れが生じるのは,石の隙間のような凹形状である 逆に凸の形状は,石の角の部分のように,積石の形態を特 徴付けている場合が多いと考えられる.そこで本研究で は,石垣の多面体モデルの凸部の形状を保存し,凹部の形 状の荒れだけを除去する手法として,以下に示すような幾 何的な変換手法を用いることにした.先端が半球状の棒 (これをプローブと呼ぶ)を用意し,これを石垣モデルの 表面に押し付けながら,モデル上を縦横に滑らせる.この とき棒の中心軸の方向は,スケッチを作成する際に石垣を 観察する方向と一致させる.プローブの直径を適切に与え ると,図4に示すように,プローブの先端が石と石の隙間 には入り込むが,隙間の底面に生じている荒れは跨ぐよう にすることができる.

プローブの先端の掃引形状(図中の太線)は,石垣モデルの形状とほぼ一致しているが;

- プローブが跨ぎ超えたので隙間部分(凹形状)の荒れ は消失している,
- 積石の形状を特徴付ける凸形状は保存されている,

ので,この形状は,もとの石垣モデルと比較して,積石の パターンをより鮮明に表現したものになる.プローブの掃 引形状では,石の側面の凹みも埋もれて再現されないこと になるが(図中の円で囲んだ部分),もともとこの凹みは スケッチの際の観察方向からは見えない場所にあるので, 問題にはならない.

図 5: プローブの掃引形状の計算手順.プローブの逆形状 ともとの石垣モデルのミンコウスキ和 (Step 1).プローブ 形状と Step 1 で得られた形状のミンコウスキ和 (Step 2).

#### 2.2 計算手順

上述の石垣モデルの鮮明化処理は,以下の2ステップで 計算できる.

- Step 1 プローブを,先端の半球の中心を通過する軸の周 りに180°回転させた逆形状を考える.この逆形状を, 半球の中心が常に石垣モデルの表面に存在するよう に保ちつつ縦横に移動させ,掃引形状を生成する(図 5(a)参照).この処理は,ミンコウスキ和とよばれる, 二立体のベクトル和の計算に相当する.
- Step 2 プローブ形状を,その中心が常に Step 1 で得られた掃引形状の最上面に存在するように保ちつつ移動させ,再度掃引形状を計算する(図 5(b)参照).得られた掃引形状の最下面が鮮明化した結果に対応する.

図 5(a) と (b) を比較すれば分かるように,二つの処理は 幾何的に同じ手続きの繰り返しとなる.したがって,Step 1において,石垣モデルとプローブの逆形状のミンコウス キ和の最上面を多面体形式で出力できれば,同じ処理を, 得られた多面体とプローブ形状に対して上下逆向きに施す ことで Step 2 が実現できる.そこで以下では,Step 1 の 実現法についてのみ議論する.



図 6: 球の掃引形状の構成要素.頂点 v を中心とする球面 (a),辺eを中心軸とする円筒形(b),面fを中央面とする 厚板形状 (c).

#### デジタルオフセット 3

石垣形状を表す多面体モデルとプローブの逆形状のミン コウスキ和を,高速に計算する技術を示す.この手法は, 以下に示す二つの特徴を持つ.

- 逆オフセット法 ミンコウスキ和を,視線に垂直な平面上 に用意された直交格子に基づいて離散的に計算する.
- ハードウェアの利用 レンダリング用ハードウェアの隠面
- これら二つの手法を,デジタルオフセットと総称する.

#### 3.1逆オフセット法

ミンコウスキ和の最上面は,プローブの逆形状の上端の 半球の移動により生成される.そこでプローブの逆形状の 代わりに,上端と同一半径rの球を,その中心が常に石垣 モデルの表面に存在するように滑らせた時の,掃引形状の 計算を考える.この計算は,石垣モデルをrだけオフセッ トする処理と同じなので、以後は「ミンコウスキ和」の代 わりに「オフセット」という用語を用いる.石垣モデルが 多面体形状のとき,球の掃引形状は,多面体の全ての頂点 v,辺e,多角形fを,以下の手順で球面,円筒形,厚板 形状に置き換えた時の集合和となる(図6参照).

頂点 頂点 v を中心とする,半径 r の球面に置き換える.

- 辺辺 eを中心軸とする,半径rの円筒形に置き換える.
- 多角形 多角形 f を中心面とする,厚さ 2r の厚板形状に 置き換える.



図 7: xy-平面上の格子から伸びた垂直な直線と要素形状 の交点のうち,最も上方の点を選択した結果.

石垣形状を精密に測定し多面体化した場合、そのポリゴ ン数はしばしば数十万枚を超える.上述した手法による掃 引形状の計算では,膨大な回数の集合演算を繰り返すこ とになり,実用的ではない.逆オフセット法は,最終的に 必要になるのが,ミンコウスキ和の最も上側の面(=オフ セット面)だけであることに着目し,以下の手順で離散的 に処理することで,効率的かつ安定な計算を実現する[3].

まず処理の基準となる直交座標系を,図7に示すよう 消去機能を用いて,逆オフセット法を高速処理する. に,その ∞軸が石垣の観察方向の逆方向を指すように与え る.そして座標系の xy-平面上に, x 軸と y 軸に平行かつ 等間隔な直交格子を,球の掃引形状の xy-平面への投影を 覆うように生成する.格子間隔 w を小さくするほど精密 な計算が可能になるが,必要な記憶容量が膨大なものにな る、本研究では、精度と利用可能な記憶容量の両方を勘案 して,格子の総数が1000×1000個程度になるように,格 子間隔を調整した.

> 各格子について, その中心を通過する z 軸に平行な直線 を考え,この直線と球の掃引形状を構成するすべての球 面,円筒形,厚板形状の交差を調べる.そして最も上側の 交点, すなわち z 座標値が最大の交点を選択する(図7参 照).この処理をすべての格子について繰り返すと,オフ セット面を覆う稠密な点群を得ることができる.これらの 点は格子状に配置されているので,隣接する点を適切に選 択しポリゴンへ置き換えることで,逆プローブの掃引形状 を表す多面体を計算できる.

3.2ハードウェアの利用

3次元コンピュータグラフィックスでは,他の面に隠さ れて観察者から見えない「隠面」を消去した画像を生成す



図 8: デプスバッファを用いた隠面消去.

るために,デプスバッファを用いる.図8のように配置された2個の立方体を図の左側から観察した画像を,平行 投影により画面へ描く場合を例に,この技術を説明する. 処理の基準となる座標系を画面の左下隅に,その x 軸と y 軸が画面を構成するピクセルの格子と平行になるように, また z 軸の方向が観察者の視線方向と逆向きになるように 与える.また各ピクセルと1対1に対応する要素からな る,デプスバッファと呼ばれる配列を用意し,その全要素 に初期値として十分に小さな数値を与えておく.

以上の準備の後,立方体を構成する多角形を順に画面へ 描画していく.その際に,各ピクセルへ投影される多角形 上の点の z 座標値を計算し,対応するデプスバッファ要素 の値(これをデプス値とよぶ)と比較する.もしも z 座標 値がデプス値よりも大きいときには,ピクセルを多角形の 色で染め,その z 座標値を新しいデプス値として記録す る.この処理をすべての多角形について繰り返すと,デプ スバッファの各要素には,視点に最も近い多角形上の点の z 座標値が格納される.また各ピクセルには,その点の色 が染められることになり,結果として隠面を消去した画像 が画面に描かれる.

画面のピクセル群を xy-平面上の直交格子と対応付け ると,

- すべての格子について、その中心を通過する z 軸に平行な直線と、球の掃引形状の最上面の交点を計算すること。
- 掃引形状を構成するすべての球面,円筒形,厚板形状 を平行投影した画像を,デプスバッファを用いて描く こと.

は,等価な処理になる.全球面,円筒形,厚板形状を描き 終えたとき,デプスバッファの各要素には,対応する直線 と掃引形状の最も上側の交点のz座標値がデプス値として 格納されているので,その値から,石垣モデルを半径rだ けオフセットした形状を表す点群を,容易に得ることがで きる[4][5].



図 10: 鮮明化した石垣モデルの部分拡大.

多くのレンダリング・ハードウェアは,デプスバッファ を用いた多面体の隠面消去処理を,直接実行する機能を備 えている.したがって掃引形状を構成する球面と円筒形を 適切に多面体近似し,近似球面,近似円筒形,厚板形状群 を平行投影した画像を,レンダリング・ハードウェアを用 いて描画することで,オフセット面を高速に計算できる. レンダリング用 LSI は,今後の高速化が最も期待されて いる半導体デバイスなので,その機能を利用することで処 理を将来さらに高速化できる.

## 4 計算実験

本手法の有効性を検証するために,石垣の多面体モデル を与えると,その石積パターンを鮮明化した画像を出力す るプログラムを試作し,計算実験をおこなった.利用した 計算機は,Intel Xeon(2.0GHz)を CPUとする,主記憶 2GBのワークステーションである.このワークステーショ ンには,NVIDIA社のQuadro4700XGLとよばれるレン ダリング用LSIが搭載されている.実験における逆オフ セット法の計算では,格子の総数が1000×1000になるよ うに調整した直交格子を用いた.本研究では,グラフィッ クスライブラリとしてOpenGLを利用した.OpenGLに は,デプスバッファの値を参照する関数が用意されており, デプス値を自由に取り込み処理に利用できる.

レンダリング用ハードウェアの機能を用いて, Step 1 の 処理を行う関数を作成し, この関数の出力する逆プロー ブの掃引形状の最上面のデータを,上下逆にして再度同 じ関数に入力することで Step 2 の処理を行った.図2 に 示した,454,178 枚のポリゴンからなる石垣モデルを入力



図 9: 図 2 に示した石垣の多面体モデルの石積のパターンを鮮明化した結果.

し,その荒れた形状を提案した手法を用いて除去し,石積 みパターンを鮮明化した結果を図9に示す.またその部分 拡大図を図10に示す.一見して明らかなように,図2と は比較にならないほど,積石の状態がはっきりと表示され Step 2 の計算時間を合計して 7.68 秒であった.

#### 5 まとめ

遺跡発掘では、石垣に積まれた石の状態をスケッチし、 記録する作業がよく行われる.埋蔵文化財の形状を3次元 的に記録するデジタル・アーカイブ技術を用いて,石垣の 記録作業を効率化する研究が進んでいる.しかしレーザ・ レンジファインダによる手法では,石と石の隙間部分を精 度よく測定できないため,得られた石垣の多面体モデルに 荒れた形状が生じてしまう.隙間部分の形状の「荒れ」を 除去し,石積みの状態をより鮮明に表示するために,多面 体のオフセット技術に基づく新しい手法を開発した.

この手法は,石垣の多面体モデルを構成する各ポリゴン に対して,オフセット処理を上方向と下方向に2回施すこ とで,石垣の隙間部の荒れを選択的に除去する.石垣モデ ルは、数十万におよぶ微細なポリゴンからなるため、従来 のソフトウェアによる処理では,計算時間と安定性に問題 があった.レンダリング用ハードウェアを用いたデジタル なオフセット技術を用いることで,この処理をごく短時間 に,しかも安定におこなうことに成功した.プログラムを 試作し計算実験をおこなうことで,提案したアルゴリズム の有効性を検証した.

提案した手法では、プローブの半径を、石と石の隙間に

は入るが隙間の底面の荒れは跨ぐように決める必要があ る.現在の実装では,この値を処理結果を見ながら試行錯 誤的に与えている.将来的には,この値を自動決定し,さ らには鮮明化された石垣の多面体モデルから,石積み状態 ていることが分かる.この処理に要した時間は,Step1とのスケッチを自動生成する方向へ研究を進めたい.本研究 を進めるにあたって,日立エンジニアリング(株)より, 石垣の形状データをご提供いただいた.この場を借りて深 く感謝する.

### 参考文献

- [1] 塚本敏夫:考古遺物用 3D ディジタルアーカイブシス テムの開発とデータ活用法の研究,情報処理,43,10 (2002) 1070.
- [2] 神鳥泰章, 鈴木宏正, 金井 崇, 木村文彦: 測定点群か らの三角形メッシュ生成(第2報)—初期メッシュの 改良法—,精密工学会誌,64,10 (1998) 1471.
- [3] 近藤 司, 岸浪建史, 斎藤勝政: 逆オフセット法をもと にした形状加工,精密工学会誌,54,5(1988)971.
- [4] K. E. Hoff III, T. Culver, J. Keyser, M. C. Lin and D. Manocha: Fast Computation of Generalized Voronoi Diagrams Using Graphics Hardware, Computer Graphics Proc., SIGGRAPH 99 (1999) 277.
- [5] 乾正知,垣尾良輔: NC加工命令の高速な生成手法 逆オフセット法のハードウェアによる高速化---,精密 工学会誌, 66, 12 (2000) 1901.